

界面ナノ電子化学研究会は半導体ウェットプロセスに関する様々な企業、研究機関および大学関係者により、半導体製造プロセスの学術的な解明、発展への貢献を重ねてきました。2016年からは更なる発展のために、活発な議論、関係者の交流、若手技術者の育成を目的とした合宿形式のフォーラムを開催してきました。コロナ禍においてはオンラインでの開催を余儀なくされましたが、今回は6年ぶりに対面にて開催することに決定しました。"歴史を学ぶ、先端プロセスを知る"というテーマを掲げ、著名な方々より興味深い講演を聴講し、様々な年代、幅広い職種の関係者が2日間にわたり学び、交流し、議論する場を提供します。

### 「歴史を学ぶ、先端プロセスを知る」

# INEF2024

- 主催： 公益社団法人応用物理学会 界面ナノ電子化学研究会(INE)
- 日時： 2024年11月8日(金)12:45~9日(土)12:10
- 場所： ダイキンアレス青谷  
〒689-0535 鳥取県鳥取市青谷町井手572  
《交通》JR鳥取駅より車40分、JR青谷駅より徒歩17分  
鳥取空港より車30分



#### ■プログラム(予定)：

1日目(11月8日 金曜日)

12:45~13:10 オープニング

13:10~14:10 招待講演「Si表面のウェットプロセスの歴史や今後への展望」  
寺本章伸先生(広島大学)

14:10~15:10 招待講演「CMOSイメージセンサプロセスの歴史と今後の展望」(仮)  
岩元勇人様(ソニーセミコンダクタソリューションズ)

15:10~17:00 休憩(客室チェックイン)

17:00~18:00 おたのしみ講演「なぜ、欧州人はワインを飲むのか？」  
近藤誠一様(レゾナック)

18:00~20:30 第36回カサロス(懇親会)

2日目(11月9日 土曜日)

9:00~10:45 育成WGチュートリアル

「軟X線放射光光電子分光を活用した表面・界面反応の"その場"分析」  
吉越章隆先生(原子力科学研究所)

11:00~12:00 招待講演「先端チップレット集積の研究開発動向」  
井上史大先生(横浜国立大学)

12:00~12:10 クロージング

#### ■申込締切：10月4日(金曜日)

#### ■参加費：

	本日~9月6日まで	9月7日~10月4日まで
応物会員	¥22,000	¥27,000
一般会員	¥27,000	¥32,000
学生	¥12,000	¥17,000

※参加費、宿泊費(相部屋となります)、懇親会費を含みます

※キャンセル料は10月5日以降100%発生します

#### ■定員： 先着80名

#### ■申込： イベントペイよりお申し込みください(クレジットカード払いのみ)

[https://eventpay.jp/event\\_info/?shop\\_code=0672069005389223&EventCode=7357829927](https://eventpay.jp/event_info/?shop_code=0672069005389223&EventCode=7357829927)

## ポスター発表展 同時開催



イベントペイQRコード

INEF2024実行委員長：有馬健太(大阪大学)

問合せ先： 永淵琢也(日本インテグリス) Takuya.Nagafuchi@entegris.com

徳久智明(関東化学) tokuhisa-tomoaki@kanto.co.jp